

保護膜付き多層膜ミラーの水素ブリスタ耐性評価

戸室, 啓明

<https://hdl.handle.net/2324/6787636>

出版情報 : Kyushu University, 2022, 博士 (工学), 課程博士

バージョン :

権利関係 : Public access to the fulltext file is restricted for unavoidable reason (3)

氏 名	戸室 啓明			
論 文 名	保護膜付き多層膜ミラーの水素ブリスタ耐性評価			
論文調査委員	主 査	九州大学	教授	吉武 剛
	副 査	九州大学	教授	浜本 貴一
	副 査	九州大学	准教授	橋爪 健一

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本論文は、極端紫外線リソグラフィに用いられる Mo/Si 多層膜ミラーの水素ブリスタ形成を、高周波水素プラズマを適用することで調査し、水素ブリスタ発生を抑制する方法を見いだすとともに、ブリスタの形成メカニズムに関して多くの知見を得ており、半導体プロセス工学に寄与するところが大きい。よって、本論文は博士（工学）の学位に値するものと認める。